

# **Электронно-лучевая литография на оборудовании Raith GmbH: от идеи до реализации**

Научно-практический семинар  
28 мая 2012 года

# Программа семинара

Время	Доклад	Докладчик
11.00-11.10	Вступительное слово	<b>Мальцев Петр Павлович</b> д.т.н., профессор, директор ИСВЧПЭ РАН, Москва
11.10-11.20	Welcome and “About Raith company”	<b>Dirk Brueggemann</b> Director Sales New Markets, Raith GmbH, Germany
11.20-11.30	ОПТЭК представляет высокотехнологичные решения для науки	<b>Власенко Вячеслав Сергеевич</b> Руководитель направления материаловедения, ООО «ОПТЭК», Москва
11.30-12.15	Raith product portfolio and applications	<b>Martin Kirchner</b> Director Sales New Markets, Raith GmbH, Germany
12.15-12.30	<b>Coffee break</b>	
12.30-13.00	Основные достижения Учреждения Российской академии наук Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН (ИСВЧПЭ РАН) в области создания монокристаллических интегральных схем СВЧ диапазона	<b>Федоров Юрий Владимирович</b> Зав.Лаб. ИСВЧПЭ РАН, Москва
13.00-13.30	Resistless Lithography with Raith ionLiNE. Instrument concept and applications	<b>Sven Bauerdick</b> Product Manager, Raith GmbH, Germany
13.30-14.00	Разработка технологии изготовления матрицы линз Френеля с помощью Raith QUANTUM	<b>Гончаров Антон Сергеевич</b> инженер НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
14.00-14.20	Методы экспонирования без стыковки полей	<b>Литвин Леонид Владимирович</b> application scientist, Raith GmbH, Germany
14.20 -15.30	<b>Обед</b>	

# Экскурсия для ознакомления с работой электронно-лучевого литографа Raith 150TWO

Дата	Время	Группа
29 мая	11.00-12.00	Группа 1
30 мая	11.00-12.00	Группа 2
31 мая	11.00-12.00	Группа 3
1 июня	11.00-12.00	Группа 4
2 июня	11.00-12.00	Группа 5

С 29 мая по 2 июня у Вас есть возможность посетить лабораторию ИСВЧПЭ РАН, подав заявку в день проведения семинара (28 мая) на стойке регистрации.